附件：

会议审定、预审和讨论的标准项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计划文号及编号 | 项目名称 | 牵头单位 | 备注 |
| 第一组 |
|  | 工信厅科函[2019]276号2019-1558T-YS | 多晶硅行业绿色工厂评价要求 | 新特能源股份有限公司 | 审定 |
|  | 中色协科字[2020]8号2020-024-T/CNIA | 氮化硅造粒粉 | 新疆晶硕新材料有限公司 | 审定 |
|  | 国标委综合[2014]89号 20141761-Q-469 | 多晶硅和锗单位产品能源消耗限额（多晶硅部分） | 洛阳中硅高科技有限公司 | 预审 |
|  | 工信厅科函[2020]181号2020-0720T-YS | 六氯乙硅烷中杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 洛阳中硅高科技有限公司 | 预审 |
|  | 中色协科字[2020]8号2020-026-T/CNIA | 半导体硅材料行业用高纯丁腈手套 | 苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司 | 预审 |
|  | 计划已入库2020104504 | 流化床法颗粒硅 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 | 讨论 |
| 第二组 |
|  | 国标委发[2019]40号20194172-T-469 | 刻蚀机用硅电极及硅环 | 有研半导体材料有限公司 | 审定 |
|  | 国标委发[2019]40号20194174-T-469 | 电子级多晶硅 | 江苏鑫华半导体材料科技有限公司 | 预审 |
|  | 国标委发[2020]37号20202892-T-469 | 硅单晶中氮含量的测定 二次离子质谱法 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 预审 |
|  | 国标委发[2020]53号20204891-T-469 | 硅片表面光泽度的测试方法 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 | 预审 |
|  | 国标委发[2021]12号20210889-T-469 | 硅和锗体内少数载流子寿命的测定 光电导衰减法 | 有研半导体硅材料股份公司 | 讨论 |